

Prensa Térmica Automática A Vácuo De 10T Para Prensagem De Laboratório De Precisão

Número do item: XP32



introdução

Prensa térmica automática a vácuo de bancada de alta precisão (10T) com platens aquecidos de 200x200mm e bomba de vácuo rápida para cura de polímeros, ligação de eletrodos de baterias e pesquisa de materiais. Ideal para ambientes de laboratório que exigem aquecimento uniforme e controle preciso de pressão, certificada pela CE com tela sensível ao toque programável.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Laminação de Filme de Polímero	Laminação de folhas ou filmes de polímeros sob calor e vácuo para criar estruturas multicamadas.	Pressão e temperatura uniformes evitam empenamentos e vazios.
Ligação de Eletrodo de Bateria	Ligação de materiais de eletrodo em coletores de corrente para baterias de íons de lítio ou estado sólido.	A purga de gás inerte evita oxidação, garantindo alta condutividade.
Compactação de Pó (com Matrizes)	Compactação de pós metálicos, cerâmicos ou compósitos em pastilhas densas usando uma matriz menor.	Alta pressão até 50,9 MPa alcançável com matriz de Ø50 mm.
Processamento de Filme Fino	Cura e recozimento de filmes finos para aplicações eletrônicas e de sensores.	Controle preciso de temperatura até 300°C com ambiente de vácuo.
Sinterização de Cerâmica	Sinterização de estágio inicial de corpos verdes de cerâmica sob calor e pressão combinados.	Porosidade reduzida e propriedades mecânicas melhoradas.
Cura de Material Compósito	Cura de pré-impregnados de fibra de carbono ou fibra de vidro.	A distribuição uniforme de pressão garante a qualidade da laminação.
Encapsulamento de Eletrônicos Orgânicos	Encapsulamento de dispositivos eletrônicos orgânicos sensíveis sob atmosfera inerte.	Ambiente livre de oxigênio estende a vida útil do dispositivo.

Parâmetro	Especificação	Notas
Modelo	XP32	Prensa a vácuo aquecida automática
Pressão Máx. de Trabalho	≤ 10 Toneladas (100 kN)	Controlado via sistema programável
Precisão da Pressão	± 0,1 Tonelada (1 kN)	Feedback de carga de alta precisão
Temp. de Trabalho do Platen	Temp. Ambiente (RT) - 300 °C	Tela sensível ao toque PID programável
Potência de Aquecimento	3500 W	Conjunto de elementos de aquecimento de alta densidade
Dimensões do Platen	200 mm × 200 mm	Platens retificados planos
Abertura do Platen (Luz)	50 mm	Abertura compacta para ciclo de vácuo rápido
Bomba de Vácuo Incluída	Bomba Mecânica de Palhetas Rotativas	Inclusão padrão
Deslocamento da Bomba de Vácuo	240 L/min (8,5 CFM)	Capacidade de evacuação de alta velocidade

Parâmetro	Especificação	Notas
Nível de Vácuo Último	< -0,1 MPa	Pressão manométrica relativa
Atmosfera de Trabalho	Nitrogênio (N ₂) / Argônio (Ar)	Compatível com vácuo e purga
Alimentação	CA 208V / 60Hz (Monofásico)	Otimizado para instalações institucionais dos EUA
Certificação	Certificado CE	Conformidade de segurança padrão

Opção	Controlador Padrão (Incluído)	Upgrade de PLC Industrial Avançado (Opcional)
Interface	Tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas	PLC industrial Siemens com tela sensível ao toque de alta resolução
Funções Principais	Perfilamento básico de temperatura PID, entrada de pressão alvo, manutenção automática, descompressão temporizada automatizada	Perfilamento complexo multipasso de temperatura/pressão, armazenamento de receitas (até 99 perfis), feedback de célula de carga de precisão, registro de dados via Ethernet
Ideal Para	Laminação padrão, cura de polímeros, prensagem simples de pastilhas	Pesquisa acadêmica, padrões de teste ASTM, processos que exigem compensação precisa de pressão passo a passo